# 非線形光吸収を利用した酸化物銅ナノ粒子の金属還元

# 3次元微細加工法の基礎的研究

名古屋大学大学院 工学研究科 マイクロ・ナノ機械理工学専攻 助教 溝尻 瑞枝 (平成 26 年度一般研究開発助成 AF-2014206)

キーワード:フェムト秒レーザ,非線形光吸収,還元描画,微細加工

# 1. 研究の目的と背景

フェムト秒レーザパルスが誘起する非線形光吸収は,感 光性樹脂の3次元直接描画法として注目されている1-2). この手法では、感光性樹脂に対して高い透過率を有する、 近赤外光フェムト秒レーザパルスを利用する.これらのパ ルスを感光性樹脂の内部で集光すると, 焦点近傍のみで主 に2光子吸収を基本とする非線形光吸収が生じ,光化学反 応による重合が生じる.この原理を利用して,集光スポッ トを感光性樹脂内部で3次元的に走査することによって, 3 次元微細構造を直接描画形成することが可能である.2 光子吸収の場合, 焦点近傍で生じる光吸収は, 光強度の2 乗に比例する. つまり, パルスエネルギーを制御すること によって,スポット径以下の高空間分解能の加工が可能で ある. 従来の1光子吸収を利用する光重合において、その 加工分解能は回折限界によって制限される.一方,非線形 光吸収を利用する場合,その回折限界を超えた,高い加工 分解能を達成する.このような3次元直接描画法は、3次 元マイクロポンプなどの描画形成をはじめ、多くの Micro Electro Mechanical Systems (MEMS) デバイスの作製への 応用が報告されている<sup>3)</sup>.

近年では、金属イオンの光還元を利用した、AuやAgの 貴金属3次元微細構造の直接描画にも応用されている4-6. これらの研究では、Au や Ag イオンが分散されたポリマ ー溶媒内部にフェムト秒レーザパルスを集光し、その焦点 近傍のみで生じる非線形光吸収を利用することによって, ポリマー溶媒内部に貴金属を還元析出し、3次元微細構造 を直接描画形成することができる.しかしながら,現状の 金属微細構造形成への応用は、Au や Ag に限定されてい る. その理由として, Auや Agは, Cuやその他の金属に 比べて還元しやすいこと,更に,Cu イオンの吸収が近赤 外光において大きいことが考えられる.特に、Cu イオン の光還元に応用する際,近赤外光フェムト秒レーザを集光 照射すると,近赤外光の1光子吸収係数が大きいため,照 射したフェムト秒レーザパルスは、Cu イオン含有溶媒の 表面から線形的に光吸収が生じる.その結果,2光子吸収 をはじめとする,非線形光吸収による内部描画が困難であ ると考えられる.

Cu は導電率が高く,これまで3次元微細構造形成の報告があるAuやAgに比べて安価な材料である.もしCuの3次元微細構造の直接描画形成に,非線形光吸収が誘起す

る内部描画を利用できれば, MEMS やマイクロデバイス の作製プロセスにおいて,大変有用な加工技術となると期 待できる.

一方で我々はこれまでに,フェムト秒レーザ還元直接描 画法に関する研究を行ってきた<sup>7)</sup>.本手法では,CuOナノ 粒子と還元剤の混合溶液にフェムト秒レーザパルスを集 光し、レーザ光が誘起する熱還元を利用することによって、 Cu 微細構造を直接描画形成することができる. これまで に、2次元 Cu 微細構造の直接描画と、それらを積層造形 することによって、3次元 Cu 微細構造の作製を行ってき た<sup>8)</sup>. 本手法では,バンドギャップ 1.2 eV の CuO ナノ粒 子を原料粉末として用いるため、波長1033 nm 以下のレー ザ光は、すべて CuO ナノ粒子に吸収される<sup>9</sup>. つまり、近 赤外光フェムト秒レーザ(波長~800 nm)を照射した場合, 基本波の1光子吸収が大きく、内部描画は不可能である. 一方で、Cu<sub>2</sub>Oのバンドギャップは 2.1 eV(波長~590 nm) である.つまり,近赤外光フェムト秒レーザの基本波長に おける光吸収が小さく、その半波長で大きな吸収があれば、 非線形光吸収を利用して,内部描画を行える可能性がある. 更に, 還元剤に分散させることで, 非線形光吸収と, それ に誘起された還元により,3次元 Cu 微細構造の直接描画 も期待できる.

本研究では、近赤外光フェムト秒レーザパルスが誘起す る非線形光吸収を利用し、3次元 Cu 微細構造を直接描画 形成するための基礎検討を行った.具体的には、初めに Cu<sub>2</sub>O ナノ粒子を、ポリオール法を用いて調製し、その線 形及び非線形吸収特性を評価した.次に、Cu<sub>2</sub>O ナノ粒子 をガラス基板上に塗布し、近赤外フェムト秒レーザパルス を集光照射することによって、描画形成されたパターンの 結晶構造評価を行った.

#### 2. 実験方法

### 2・1 提案するプロセス

図1に、実験プロセスを示す.初めにCu<sub>2</sub>Oナノ粒子を、 ポリオール法を用いて調製する.次にCu<sub>2</sub>Oナノ粒子を含 む懸濁液からCu<sub>2</sub>Oナノ粒子を遠心分離によって洗浄を行 った後、脱イオン水(DI)に分散させ、Cu<sub>2</sub>Oナノ粒子溶 液を作製する.次に、ガラス基板上に、作製したCu<sub>2</sub>Oナ ノ粒子溶液をスピンコートし、ベイクを行って不要な水分 を蒸発させる.作製されたCu<sub>2</sub>Oナノ粒子膜上に、近赤外 フェムト秒レーザパルスを集光照射し, 所望のパターンを 描画形成する.最後に, 未照射部の Cu<sub>2</sub>O ナノ粒子を除去 する. それぞれのプロセスにおける詳細を下記に示す.



図1 提案するプロセス

#### 2・2 材料調製と基板塗布

Cu<sub>2</sub>O ナノ粒子は、ポリオール法を用いて合成した<sup>10</sup>. Cu<sub>2</sub>O ナノ粒子原料として Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>を、保護安定化剤とし てポリビニルピロリドン (M<sub>w</sub>~55000, polyvinylpyrrolidone, PVP)を、還元剤としてエチレングリコール用いた.初め に、72 mM の Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>と 288 mM の PVP を、シリンジポ ンプを用いてエチレングリコール中に同時に加えた後、マ グネティックスターラを用いて攪拌した.混合速度は 45 mL/h とした.次に、遠心分離機を用いて Cu<sub>2</sub>O ナノ粒子を 分離し、エタノール用いて洗浄した.分離条件は、14500 rpm で 30 分間とした.続いて、Cu<sub>2</sub>O ナノ粒子を DI 水に 分散し、ガラス基板上にスピンコート塗布した.最後に、 80°C のホットプレートで加熱し、水分を蒸発させること によって、ガラス基板上に Cu<sub>2</sub>O ナノ粒子を膜状に塗布し た.

### 2・3 フェムト秒レーザ描画装置

フェムト秒レーザ描画には Nanoscribe 社の 3 次元マイ クロ・ナノ光造形 3D プリンタ装置(Photonic Professional GT)を用いた.レーザ波長,パルス幅,繰返し周波数はそ れぞれ,780 nm,120 fs,80 MHz であった.フェムト秒レ ーザパルスは開口数 0.75 の対物レンズを用いて集光し, サンプルをピエゾステージによって走査させることでパ ターン描画を行った.最後に,未照射部の Cu<sub>2</sub>O をエタノ ールで除去した.

# 2.4 光吸収特性評価方法

ガラス基板上に塗布した Cu<sub>2</sub>O ナノ粒子膜の透過率は, 紫外・可視分光光度計(UV2600,島津製作所社製)を用 いて評価した.更に,非線形光吸収特性は,Open-aperture Z-scan 法を用いて評価した.Z-scan 法は,光軸(z軸)上 に集光スポットを走査し、そのときの透過率とz位置の関係から非線形光吸収特性を評価する方法である<sup>11)</sup>. 透過率Tとzの関係は、次式で表される.

$$T(z) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(\beta I_0 L_{eff})^m}{(m+1)^{3/2}}$$
(1)

$$L_{\rm eff} = \frac{1 - \exp(-\alpha_0 L)}{\alpha_0}$$
(2)

ここで $\alpha_0$ は1光子吸収係数, $\beta$ は2光子吸収係数,Lは膜厚である.

# 2・5 パターニング評価

調製したナノ粒子は、電界放出型電子顕微鏡(Field Emission-Scanning Electron Microscopy, FE-SEM)を用いて 形状観察を行った.更に、ナノ粒子の結晶構造解析は、イ メージングプレート型エックス線回折(X-ray diffraction, XRD)装置を用いて行った.

#### 3. 実験結果

# 3・1 Cu<sub>2</sub>O ナノ粒子の合成

調製したナノ粒子をガラス基板上に塗布し, FE-SEM に より観察を行った.図2にナノ粒子のFE-SEM 像を示す. 球状の単分散ナノ粒子が得られ,その直径は約100 nm で あった.図3にナノ粒子のXRDスペクトルを示す.Cu2O に起因する回折ピークのみが観察されたことから,調製し たナノ粒子はCu2Oナノ粒子であることが明らかであり, これは参考文献と一致した<sup>10</sup>.



図 2 ナノ粒子の FE-SEM 像

#### 3.2 線形吸収特性

Cu<sub>2</sub>O ナノ粒子膜の紫外可視吸収特性を評価した. 図 4 に吸収スペクトルを示す. 近赤外フェムト秒レーザ波長 780 nm においては吸収が小さく, その半波長以下で大き な吸収を有することが分かった. このことは, フェムト秒 レーザパルスが誘起する非線形光吸収により, 回折限界以 下の加工分解能, 内部描画の可能性を示唆している.



# 3・3 Z-scan 法による非線形吸収特性評価

図5に、パルスピーク強度を10 GW/cm<sup>2</sup>, 15 GW/cm<sup>2</sup>, 19 GW/cm<sup>2</sup> としたときの、透過率とz位置との関係を示す. いずれのピーク強度の条件においても、焦点位置(z=0) において大きな吸収を示した.このことは、非線形的な光 吸収が生じていることを示唆している.更に、式(1)、(2)を 用いてフィッティングを行ったところ、低ピーク強度条件 においてはほとんど一致した.高強度条件において、実験 値とフィッティング曲線との差が大きくなったのは、

Cu<sub>2</sub>O ナノ粒子が高強度レーザパルス照射により,変化したためであると考えられる.このことは,レーザスポット 通過後 (z>0) において,実験値とフィッティング値との 差が大きくなる結果からも示唆される.図6に透過率とピ ーク強度の関係を示す.吸収波はピーク強度の2乗に比例 して線形的に減少した.このことから,この非線形光吸収 は,2光子吸収過程であると考えられる.



図 5 Open-aperture Z-scan 法による透過率カーブ.



図6 透過率とパルスピーク強度の関係.

#### 3·4 描画線幅特性

パルスエネルギーを 0.16-0.78 nJ と, 描画速度を 1-1000 µm/s としたときの線幅と描画速度の関係を評価した. 線幅測定は, 未照射部のナノ粒子除去前の FE-SEM 像を用 いて行った. 図 7(a)にパルスエネルギー0.16 nJ, 描画速度 1 µm/s, 図 7(b)にパルスエネルギー0.31 nJ, 描画速度 100 µm/s で描画したラインパターンの FE-SEM 像を, 図 8 に それぞれの描画速度におけるパルスエネルギーと線幅の 関係を示す. 描画速度が 100 µm/s 以上の描画条件におい ては, 高速描画である程, 線幅は減少する. これは単位面 積当たりに照射されるエネルギーが減少することと一致 する. 一方で, 描画速度 1 µm/s においては, 100 µm/s 以 上のいずれの条件よりも, 単位面積当たりに照射されるエ ネルギーは増加するにもかかわらず, 線幅は減少した. 特 に, 0.16-0.47 nJ においては, 1/e<sup>2</sup> 半径 1.3 µm 以下とな る, 回折限界以下の線幅のパターンが得られた. これらの 結果は、次のように考察される.100 µm/s 以上の描画速度 条件においては,吸収されたフェムト秒レーザパルスが熱 エネルギーに変換され、その後、熱拡散することにより、 線幅増大が生じていると考えられる.一方,1µm/sの低速 描画条件においては、フェムト秒レーザパルスが集光スポ ットで吸収されて Cu<sub>2</sub>O が急激に加熱された後も、更なる 後続パルスが入射される. Cu<sub>2</sub>O は半導体であり,吸収係 数の温度依存性が大きいことから、後続パルスは熱エネル ギーに変換されるのではなく,非線形吸収に消費されるこ とから、熱影響が減少するのではないかと推察される.

# 3·5 描画パターンの XRD スペクトル

ラスター走査により 300 µm×900 µm のパターンを描画 した. 描画速度 100 µm/s, パルスエネルギー0.31 nJ とし, ラスターピッチは 2 μm とした. 図 9 に XRD スペクトル を示す. 原料ナノ粒子の Cu2O に起因する回折ピークの他 に、Cuに起因する回折ピークが観察された. このことか ら, Cu2O は残存しているものの, Cu パターンが描画形成 できることを示した. Cu2O ナノ粒子の還元については, ナノ粒子合成において PVP を用いており、ナノ粒子表面 に残存する PVP が Cu<sub>2</sub>O の還元に寄与したと考えられる.





図7 (a), (b) ラインパターンの FE-SEM 画像及び, (c)線 幅とパルスエネルギーの関係.



# 4. まとめ

l/e<sup>2</sup> radius

1 µm

WD 40.1

本研究では、非線形光吸収を利用した3次元Cu微細構 造の直接描画形成をめざし、Cu2O ナノ粒子の非線形吸収 特性を評価した. 更に, Cu2O ナノ粒子の還元描画時のパ ターニング特性を評価した.

- (1) Cu<sub>2</sub>O ナノ粒子薄膜は、非線形光吸収特性を有し、その 2光子吸収係数は、43-105 cm/GW と見積もられた.
- (2) 描画後の最小線幅は、スポット径 1.3 µm 以下となっ た. この結果からも、ラインパターンは非線形光吸収 により描画形成されたと考えられる.

今後, Cu<sub>2</sub>O ナノ粒子をより厚膜に堆積させることによ って,3次元Cu微細構造形成が期待できる.

# 謝 辞

本研究の一部は, 文部科学省ナノテクノロジープラット フォーム事業(微細加工プラットフォーム)の支援により 名古屋大学で実施されました.また,本研究は, JSPS 科研 費 16H06064 の助成と、公益財団法人 天田財団 2014 年一

般研究開発助成 (AF-2014206) の助成を受けて実施された ことを記し、心より謝意を示します.

# 参考文献

- S. Maruo, O. Nakamura, and S. Kawata: "Three-dimensional microfabrication with two-photon-absorbed photopolymerization", Optics Letters, Vol.22, No.2 p.132 (1997)
- S. Kawata, H. B. Sum, T. Tanaka, K. Takada: "Finer features for functional microdevices", Nature, Vol.412, No.6848 p.697 (2001)
- S. Maruo and H. Inoue: "Optically driven micropump produced by three-dimensional two-photon microfabrication", Applied Physics Letters, Vol.89, No.14 p.144101 (2006)
- 4) T. Tanaka, A. Ishikawa, and S. Kawata: "Two-photon-induced reduction of metal ions for fabricating three-dimensional electrically conductive metallic microstructure", Applied Physics Letters, Vol.89, No.8, p.081107 (2006)
- 5) A. Ishikawa, T. Tanaka, and S. Kawata: "Improvement in the reduction of silver ions in aqueous solution using two-photon sensitive dye", Applied Physics Letters, Vol.89, No.11 p.113102 (2006)
- S. Maruo and T. Saeki: "Femtosecond laser direct writing of metallic microstructures by photoreduction of silver nitrate in a polymer matrix", Optics Express, Vol.16, No.2 p.1174 (2008)

- 7) M. Mizoshiri, S. Arakane, J. Sakurai, and S. Hata: "Direct writing of Cu-based micro-temperature detectors using femtosecond laser reduction of CuO", Applied Physics Express, Vol.9, No.3 p.036701 (2016)
- 8) S. Arakane, M. Mizoshiri, J. Sakurai, and S. Hata: "Direct writing of three-dimensional Cu-based thermal flow sensors using femtosecond laser-induced reduction of CuO nanoparticles", Journal of Micromechanics and Microengineering, Vol.27, No.5 p.055013 (2017)
- 9)B. Kang, S. Han, J. Kim, S. Ko, and M. Yang: "One-Step Fabrication of Copper Electrode by Laser-Induced Direct Local Reduction and Agglomeration of Copper Oxide Nanoparticle", The Journal of Physical Chemistry C, Vol.115, No.48 p.23664 (2011)
- 10) M. H. Kim, B. Lim, E. P. Lee, Y. Xia: "Polyol synthesis of Cu<sub>2</sub>O nanoparticles: use of chloride to promote the formation of a cubic morphology", Journal Materials Chemistry, Vol.18 p.4069 (2001)
- M. Sheik-Bahae, A. A. Said, T.-H. Wei, D.J. Hagan, and E. W. Van Stryland: "Sensitive Measurement of Optical Nonlinearities Using a Single Beam", IEEE Journal of Quantum Electronics, Vol.26, No.4 p.760 (1990)